

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【公開番号】特開2002-273144(P2002-273144A)

【公開日】平成14年9月24日(2002.9.24)

【出願番号】特願2001-81017(P2001-81017)

【国際特許分類】

B 01 D 53/04 (2006.01)

C 01 B 17/45 (2006.01)

C 01 B 21/083 (2006.01)

H 01 L 21/302 (2006.01)

【F I】

B 01 D 53/04 G

C 01 B 17/45 G

C 01 B 21/083

H 01 L 21/302 4 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月9日(2007.11.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 4】

そして、C F 4 + 窒素を濃縮装置22、N F 3 + 窒素を濃縮装置24に供給する。この濃縮装置22、24も上述の濃縮装置18と同じく、膜分離装置や深冷冷却装置が用いられる。特に、膜分離装置において、濃縮ガスを何度も循環したり、多段としたり、深冷冷却分離装置を用いることで、窒素をほぼ100%分離して、純粋な、濃度100%のC F 4ガスおよびN F 3ガスを得ることができる。